



제 30회 한국반도체학술대회

The 30th Korean Conference on Semiconductors

2023년 2월 13일(월) ~ 15일(수) | 강원도 하이원리조트(그랜드호텔 컨벤션타워)

2023년 2월 14일(화), 09:00-10:45

Room H (하트 I, 6층)

B. Patterning (Lithography & Etch Technology) 분과

[TH1-B] Lithography and Photoresist I

좌장: 이진균 교수(인하대학교), 정현담 교수(전남대학교)

TH1-B-1 09:00-09:30 [초청]	CAR Type EUV Resist RLS Trade-off Improvement Jeongsik Kim, Minja Yoo, Hyungkun Lee, Myounghyun Hur, and Jaehyun Kim <i>Dongjin Semichem Co., Ltd.</i>
TH1-B-2 09:30-10:00 [초청]	Molecular Simulation of LER Formation in EUV Patterning: Causes and Method for Reduction Su-Mi Hur <i>Department of Polymer Science and Engineering, Chonnam National University</i>
TH1-B-3 10:00-10:15	Near-field Infrared Nanoscopic Study of HSQ Photoresist Jiho Kim ¹ , Jin-Kyun Lee ² , Boknam Chae ¹ , Jinho Ahn ² , and Sangsul Lee ¹ <i>¹Pohang Accelerator Laboratory, POSTECH, ²Department of Polymer Science and Engineering, Inha University, ³Division of Materials Science and Engineering, Hanyang University</i>
TH1-B-4 10:15-10:30	Analysis of Extreme Ultraviolet Pellicle and Pellicle Contaminations Sang-Kon Kim <i>The Faculty of Liberal Arts, Hongik University</i>
TH1-B-5 10:30-10:45	극자외선 펠리클용 나노미터 두께의 대면적 탄화 물리브데넘 박막 김용경 ^{1,2} , 김현미 ¹ , 장성규 ¹ , 김형근 ¹ , 김슬기 ¹ , 안진호 ^{2,3} <i>¹한국전자기술연구원 융복 합전자소재 연구센터, ²한양대학교 신소재공학과, ³EUV-IUCC (Industry-University Collaboration Center)</i>